基于的模型

摘要

本文

针对问题一,

针对问题二,

针对问题三,

针对问题四,

关键词: 'xx' 'xx'

一、问题重述

1.1 问题背景

碳化硅作为第三代半导体材料的代表,因其优异的综合性能备受关注。碳化硅外延 层厚度是外延材料的关键参数,直接影响器件性能。因此,建立科学、准确、可靠的厚 度测试标准至关重要。红外干涉法是一种无损测量方法,其原理基于外延层与衬底因掺 杂载流子浓度不同而具有不同的折射率。红外光入射外延层后,部分光从外延层表面反 射,部分光从衬底表面反射回来,两束光在特定条件下产生干涉条纹。通过红外光谱的 波长、外延层折射率及入射角等参数,可确定外延层厚度。需要注意的是,外延层折射 率通常不是常数,与掺杂载流子浓度及红外光波长等因素相关。

1.2 问题提出

问题 1: 在考虑外延层和衬底界面只有一次反射、透射所产生的干涉条纹的情况下,建立确定外延层厚度的数学模型。

问题 2: 根据问题一建立的确定外延层厚度数学模型,设计其对应的算法,根据提供的碳化硅晶圆片的光谱实测数据求出计算结果,并分析计算结果的可靠性。

问题 3: 光波在外延层和衬底界面可能发生多次反射和透射,形成多光束干涉。推导多光束干涉的必要条件及其对外延层厚度计算精度的潜在影响。基于多光束干涉的条件,分析提供的硅晶圆片测试结果是否出现多光束干涉,建立硅外延层厚度计算的数学模型和算法,并给出计算结果。若碳化硅晶圆片测试结果中也存在多光束干涉,影响厚度计算精度,提出消除多光束干涉影响的方法,并给出消除影响后的计算结果。

二、问题分析

- 2.1 问题一分析
- 2.2 问题二分析
- 2.3 问题三分析

三、模型假设

- 1.
- 2.
- 3.

四、符号说明

表 1 符号说明详表

符号	说明	单位
A,B,C,\dots		-
$\theta_1, \theta_2, \theta_3$	入射角、折射角、反射角的角度	rad
c	光速,取 299,792,458m/s	m/s
$ ilde{v}$	波数	m^{-1}
ν	波长	m

注: 其他文章内使用但未在表内详细说明的符号将在使用时给出说明。

五、模型建立与求解

5.1 问题一

5.1.1 模型建立

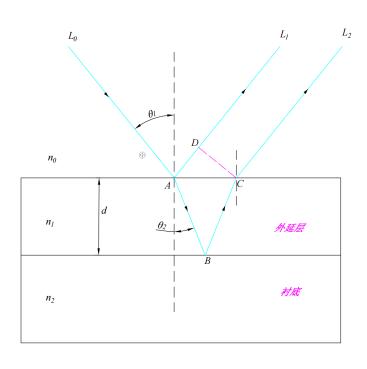


图 1 外延层红外反射示意图

图1为外延层红外反射示意图。

由于外延层上下表面反射的两束相干光 L_1 和 L_2 存在相位差,其光程差导致了干涉条纹的形成。

光程差分析

$$\Delta X = n_1(AB + BC) - n_0AD = 2n_1d\cos\theta_2 \tag{1}$$

如果 $n_1 > n_2$,图1中, L_1 在 A 点会发生 π 的反射相变, L_2 在 B 点的反射相变为 0, L_2 在 C 点的折射线和反射线的相位均与 BC 入射线相同,则有干涉条件方程组

- 5.1.2 问题求解
- 5.1.3 求解结果
- 5.2 问题二
- 5.2.1 模型建立
- 5.2.2 问题求解
- 5.2.3 求解结果
- 5.3 问题三
- 5.3.1 模型建立
- 5.3.2 问题求解
- 5.3.3 求解结果

六、模型的分析与检验

- 6.1 误差分析
- 6.2 灵敏度分析

七、模型的评价

- 7.1 模型优点
- 1.
- 2.
- 3.

7.2 模型缺点

- 1.
- 2.

7.3 改进方向

- 1.
- 2.

参考文献

- [1] 卓金武. MATLAB 在数学建模中的应用[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2011.
- [2] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用[M]. 2 版. 北京: 国防工业出版社, 2015.

附录 A 运行结果

附录 B 文件列表

表 2 程序文件列表

文件名	功能描述
code2.py	问题二程序代码
code3.py	问题三程序代码

附录 C 代码

3.1 问题 2 代码

print("Hello World")

3.2 问题 3 代码

print("Hello World")